高熵中心材料測試服務設備說明表

|  |  |
| --- | --- |
| 儀器名稱 | 中文： 高功率3D電弧及離子複合多層濺鍍系統 |
| 英文： High power 3D arc and ion composite multilayer sputtering system | 簡稱 |  |
| 廠牌 | 亮傑科技有限公司 | 國別 | 中華民國 |
| 型號 | AS602 | 放置地點 | 清華實驗室327室 |
| 主要附件 | 公轉、自轉之旋轉載台、DC Sputter、HiPIMS、電弧鍍膜系統 |
| 重要規格 | 1. 溫度範圍：RT~400 °C
2. 3吋Sputter靶功率：30~300 W
3. 6吋Arc 靶電流：50~100 A
4. 偏壓：0~700 V
5. 工作氣壓：5~30 mTorr
6. 氣體流率：3~100 SCCM
 |
| 儀器性能 | 1. 具有三種鍍膜方式DC Sputter、HiPIMS、電弧鍍膜系統
 |
| 服務項目 | 1. 以DC控制系統鍍膜
2. 以HiPIMS控制系統鍍膜
3. 以電弧控制系統鍍膜
 |
| 試片規格 | 1. 平板、棒狀物、管狀物之表面鍍膜，高度為60mm以下。
 |
| 收費方式 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 學研單位 | 業 界 |
| 開機費 | 6,000元/件 | 8,000元/件 |
| 儀器使用費 | 18,000元/件 | 24,000元/件 |

備註：1. 儀器使用費以8小時計算，若大於8小時，則每小時加收1,000元(不足1小時以1小時計)。
2. 若靶材在鍍製階段即斷裂，表示靶材本身有問題，收費不變。
3. 測試服務不包含樣品加工及處理。
 |
| 設備照片 | 高功率3D電弧及離子複合多層劍度系統 |
| 指導教授 | 林樹均教授 | TEL | (03)5715131#42620 | E-MAIL | sjlin@mx.nthu.edu.tw |
| 管理人員 | 李京穎 | TEL | (03)5715131#42621 | E-MAIL | richard850418@gmail.com |
| 委測需求 | 請與管理人員接洽及預約 |